**5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РЕЖИМАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РАЗРЯДА КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА**

В настоящее время в технологических процессах плазменной обработки материалов, в большинстве случаев применяется ВЧ или СВЧ разряд.[1]

Скорости плазмохимических реакций определяются энергией потока частиц, достигающих подложки и температурой подложки. Анализ известных на данный момент приемов организации процессов обработки поверхности материалов с использованием газовой плазмы СВЧ разряда указывает на разнообразие методов дополнительного внешнего энергетического стимулирования процессов как на поверхности пластины, так и в приповерхностном плазменном слое. Такое воздействие ускоряет протекание плазменных процессов, позволяет эффективно управлять качественным составом и энергетическими характеристиками плазмы вблизи поверхности подложки, способствует достижению более равномерного распределения характеристик плазмы в зоне формирования разряда или обработки подложек. [3]

Для этих целей можно использовать разряд комбинированного типа, формируемый путем наложения на низкочастотный или высокочастотный разряд СВЧ поля.

Выбор СВЧ и НЧ разрядов обусловлен механизмами процессов, протекающих в объемных и электродных плазменных реакторах, возможностью эффективного управления ходом технологического процесса.[3]

Процесс формирования плазмы характеризуется рядом технологических параметров. Ключевым параметрам относятся:

1. величина подаваемых мощностей от СВЧ и НЧ генераторов;
2. сорт газа используемый в процессе плазмохимической обработки;
3. рабочее давление в разрядной камере.

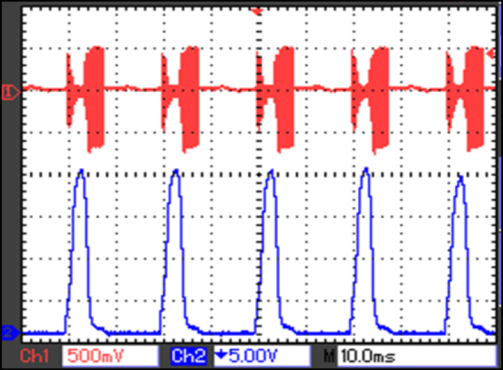
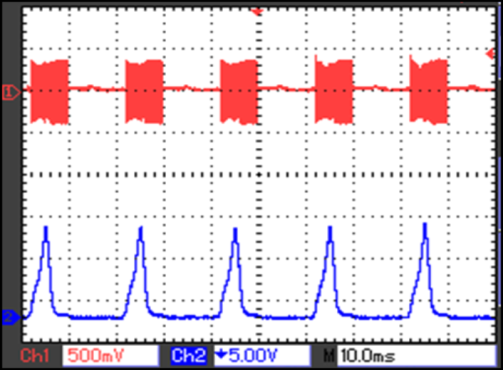
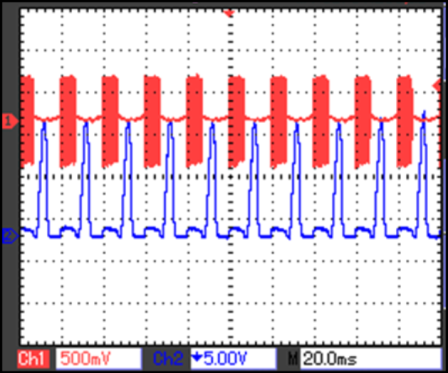
Частота СВЧ излучения была фиксирована и составляла *f*=2.45 ГГц, частота импульсов НЧ генератора могла варьироваться. НЧ генератор имел возможность работы в двух режимах – импульсном и постоянном. Постоянный режим работы НЧ генератора позволяет формировать непрерывную последовательность комбинированного и НЧ разрядов, что не всегда желательно при проведении физических и технологических экспериментов. Данный фактор обусловил выбор импульсного режима работы для проведения исследований. Каждая пачка импульсов в прерывистом режиме работы НЧ генератора следовала с частотой 50 Гц. Импульсы внутри пачки имели частоту 33 кГц.

Особенностью СВЧ разряда являлся пульсирующий характер плазмообразования, обусловленный работой источника питания СВЧ магнетрона от однополярных импульсов. При этом возможны два варианта формы сигналов высоковольтного питающего напряжения: близкий к прямоугольной и овальный. Частота следования пачек СВЧ импульсов составляла 50 Гц.

СВЧ разряд обладает гораздо большей мощностью, по сравнению с НЧ разрядом, поэтому необходимо соблюдение баланса, при котором мощность СВЧ не перекроет НЧ.

Так же необходимым фактором образования комбинированного разряда является временная синхронизация импульсов СВЧ и НЧ (рисунок5.1).

На рисунке 1 представлены варианты временного соотношения НЧ и СВЧ импульсов, при которых они следуют в разные периоды времени (1а) и существуют одновременно, но при разных давления (1б,в).



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а | б | в |

Ch1 – НЧ сигнал, подаваемый на осциллограф через делитель 1:1000;

Ch2 – импульсы оптического свечения плазмы.

Рис.5.1 – Варианты временного соотношения импульсов СВЧ и НЧ относительно друг друга:

а – импульсы СВЧ и НЧ сигналов не совпадают по времени;

б – импульсы СВЧ и НЧ сигналов синхронизированы, p=80 Па;

в – импульсы СВЧ и НЧ сигналов синхронизированы, p=30 Па.